- 120019

⑤Int.Cl.⁴
H 01 L 21/30
B 08 B 7/00
H 01 L 21/302

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)6月6日

Z-7376-5F 6420-3B

N-8223-5F

B-8223-5F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

🕺発明の名称 洗浄装置

②特 願 昭60-264800

29出 願 昭60(1985)11月27日

四発 明 者 滝 沢

芳 治

日立市東多賀町1丁目1番1号 株式会社日立製作所多賀

工場内

Ø発 明 者 大 竹

光義

横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技

術研究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑩代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 和 書

- 1 発明の名称 洗浄装置
- 2 特許請求の範囲
 - 1. 酸素ラジカルによる酸化により被洗浄物表面の有機物を除去する機能を持ち、この処理を行う洗浄室との間は開閉可能な扉で仕切られ、装置外部とも開閉可能な扉で仕切られ、内部に被洗浄物を保管する機能を持つ予備室を有する洗浄装置において、予備室内のオソンの濃度を検出する機能を持つセンサを備える事を特徴とする洗浄装置。
- 3 発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は洗枠装置に係り、例えば電子部品、 半導体等の表面の有機物の洗浄に適した洗浄装 間に関する。

(発明の背景)

従来の装置は、特別昭59-94823号, 特別昭59-94824号等の広報に記載のように被長185mmと254mmの第外線強度比及 び185 mmの紫外線強度を設定し、被洗浄物をベルトコンベアで搬送して洗浄する構造であった。しかし、洗浄の際発生するオゾンはアメリカ労働衛生専門家会議による許容濃度が G。1ppmという有害物であるにもかかわらずその流出防止に対しては何の配慮もなされていなかった。

〔発明の目的〕

本発明の目的は、洗浄処理時に発生する有害なオゾンを装置外にもらさずに、連続処理が可能な洗浄ラインに組み込む事が可能な洗浄装置を提供することにある。

〔発明の概要〕

本発明はオゾンを用い有機物を除去する洗浄 装置にオゾンの濃度を検出するセンサを備えた 予備室を設けたものである。有害ガスを用いる 洗浄室をインライン化するには、洗浄室と装置 外部との間に予備室を備け、これを経由して被 洗浄物を搬送する必要がある。これにより洗浄 室から予備室にオゾンが洗出した場合、予備室 * る。しかし排気処理が不十分な場合流出させる 、 危険があるため、予備室内のオゾン濃度を検出 し十分排気が行われた後、搬送を行う装置とし たものである。

(発明の実施例)

以下、本発明の一実施例を倒により説明する。 水銀灯3より照射される紫沙室1により発生する オゾンを用い洗浄を行う洗浄室1に降散してンサ の変2が形成されている。 予備を図り、 のかかかが変ながいる。 かの側になりの のかかが変ながいる。 かの側になりの のがかられている。 かの側になりの のがかられている。 かの側になり ののではない。 ではない。 マイクロコンピュータ13はセンサースにはない。 マイクロコンピュータ13はセンサースにはない。 マイクロコンピュータ13はセンサースにはない。 マイクロコンには、 ないのではない。 マイクロコンには、 ないのでは、 ないのではない。 マイクロコンには、 ないのでは、 ないでは、 ないのでは、 ないでは、 ないでは、 ない

· 3 ·

かを判定(ステップC)される。オゾンが許容濃 度以下になると予備室扉 5 を開き(ステップ D) 搬送腕8にて被洗浄物9を予備室2へ搬送(ス テップE)し、次いで予備室扉5を閉じる(ステ ップF)。次に洗浄室原4を開き(ステップG) 予備室搬送腕7にて被洗浄物9を予備室2から 洗浄室1の洗浄台6へ搬送し(ステップH)、次 いで洗浄室原4を閉じ(ステップI)洗浄を行う (ステップ J)。洗浄終了後、洗浄室原 4 を聞き (ステップK)、予備室搬送腕7にて洗浄室1の 洗浄台6の被洗浄物9を洗浄予備室2へ搬送し (ステップL)次いで洗浄室原4を閉じ(ステッ プM)予備室2内の雰囲気を排気する(ステップ N)。予備室2内の雰囲気中のオゾンは前記同 様センサで測定し許容濃度以下であるか判定す る(ステップ〇)。許容濃度以上であればステッ プNをくり返し、許容譲度以下であれば予備室 尿5を開き(ステップP)搬送腕8にて被洗浄物 9を予備室2から装置外部へ搬送し(ステップ へ) かいでおぬ穴間にた凹に/ステップP)枚

管11にて排気処理される。

被洗浄物9は搬送腕8と予備室搬送腕7により装置外部より洗浄室1内部に搬入されて洗浄台6上で洗浄を受け、再び予備室搬送腕7と搬送腕8により装置外部へ搬出される。搬送の際雰囲気の移動が生じ予備室2内がオソンを含む野囲気となる。このオソンの濃度が立ち合いで検出される。前記の搬送の為予備室2内容で検出される。前記の搬送の為予備室2内雰囲気が許容濃度以下であるとマイクロコンピュータ13が判断した後、扉開閉器12に信号を送り予備室扉5を開ける。

第2図は前記マイクロコンピュータ13のフローチャートを示す。次に本フローチャートに 悲づいて制御の一例を説明する。ステップAで スタートすると予備室内2の雰囲気が排気される(ステップB)。予備室内2の雰囲気中のオソ ンはセンサ14で測定され許容濃度以下である

. 4 .

了する。(ステップS)。

これにより例えば許容濃度を 0 . 1 p p m と 設定すれば、装置外部の環境は労働衛生上の許 容限度以下となる。

〔発明の効果〕

本発明は予備室内の雰囲気をモニターし、安全を確認した後に扉を開くため、有害なオゾンを装置外部に漏さずに洗浄処理が行え、作業者の安全及び周辺機器の損失防止を確保した上で洗浄ラインに組込み連続処理する事が出来る。

4 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例を示す洗浄装置の 断面図、第2回は上記洗浄装置を制御するため のマイクロコンピュータのフローチャートであ る。

1 … 洗浄室, 2 … 予備室, 3 … 水銀灯, 4 … 洗浄扉, 5 … 予備室扉, 6 … 洗浄台, 9 … 被が 浄物, 10 … 排気口, 11 … 排気管, 12 … 扉 開閉器, 13 … マイクロコンピュータ, 14 …

サンサ

